(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

特許第4697037号 (P4697037)

最終頁に続く

(45) 発行日 平成23年6月8日(2011.6.8)

(24) 登録日 平成23年3月11日(2011.3.11)

(51) Int.Cl.		F I				
HO5K 3/46	(2006.01)	HO5K	3/46	Q		
HO1L 23/12	(2006.01)	H05K	3/46	\mathbf{W}		
		H05K	3/46	N		
		HO5K	3/46	G		
		HO1L	23/12	В		
					請求項の数 6	(全 9 頁)

(21) 出願番号	特願2006-130455 (P2006-130455)	(73)特許権都	耸 000004260	
(22) 出願日	平成18年5月9日(2006.5.9)		株式会社デンソー	
(65) 公開番号	特開2007-305674 (P2007-305674A)		愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地	
(43) 公開日	平成19年11月22日 (2007.11.22)	(74) 代理人	100071135	
審査請求日	平成20年5月23日 (2008.5.23)		弁理士 佐藤 強	
		(72) 発明者	竹内 聡	
			愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地	株式会
			社デンソー内	
		(72) 発明者	神谷 博輝	
			愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地	株式会
			社デンソー内	
		(72) 発明者	久保田 克典	
			愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地	株式会
			社デンソー内	

(54) 【発明の名称】部品内蔵基板及びその配線不良検査方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板内に内蔵された電子部品の電極と基板表面に設けられた接続部との間を内部配線部で接続した多層配線基板からなる部品内蔵基板において、

前記多層配線基板の表面に設けられた検査用接続部と、

前記電子部品の電極または前記内部配線部の所定部位と前記検査用接続部との間を接続する検査用内部配線部とを備えたことを特徴とする部品内蔵基板。

【請求項2】

前記検査用内部配線部は、最短距離となるように設けられていることを特徴とする請求項 1 記載の部品内蔵基板。

【請求項3】

前記検査用内部配線部は、前記多層配線基板に形成されたビアを直線的に接続して構成されていることを特徴とする請求項2記載の部品内蔵基板。

【請求項4】

前記電子部品はチップ受動部品であり、

前記検査用接続部は、前記多層配線基板において前記接続部と反対側となる基板裏面に設けられ、

前記内部配線部は、前記チップ受動部品の電極の表面に接続され、

前記検査用内部接続部は、前記チップ受動部品の前記電極の裏面に接続されていることを特徴とする請求項1ないし3の何れかに記載の部品内蔵基板。

【請求項5】

前記多層配線基板は、熱可塑性樹脂からなる絶縁層を積層して高温高圧下で一括プレスすることにより形成されていることを特徴とする請求項1ないし4の何れかに記載の部品内蔵基板。

【請求項6】

請求項1ないし5の何れかに記載の部品内蔵基板の配線不良検査方法であって、

前記接続部と前記検査用接続部との間の抵抗値を測定し、その測定値が正常値と異なる場合は、前記内部配線部の配線不良であると判断することを特徴とする部品内蔵基板の配線不良検査方法。

【発明の詳細な説明】

10

【技術分野】

[0001]

本発明は、基板内に内蔵された電子部品の電極と基板表面に設けられた接続部との間を内部配線部で接続した多層配線基板からなる部品内蔵基板及びその配線不良検査方法に関する。

【背景技術】

[0002]

特許文献1に示されるような熱可塑性樹脂フィルムを積層して高温下で一括プレスすることにより形成するプリント基板において、基板内に例えばチップ抵抗を内蔵する場合は、図9に示すように基板101に内蔵されたチップ抵抗102の電極102aと基板表面に形成された配線103とを内部配線104やビア105により電気的に接続するようにしている。

20

【特許文献1】特開2003-086949号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

ところで、チップ抵抗に対する電気的接続の検査は、チップ抵抗を含む内部配線全体の抵抗値を測定することにより実施するが、チップ抵抗の抵抗値が大きい場合は、チップ抵抗に接続されている内部配線やビアに不具合があって抵抗値が上昇するにしても、チップ抵抗の抵抗値が、不具合による抵抗値の上昇分に対して十分に大きいという関係となる。このため、内部配線やビアの不具合による抵抗値の上昇がチップ抵抗の抵抗値に隠れてしまい、内部配線やビアの不具合を発見できないという問題点がある。

30

[0004]

本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的は、基板内に内蔵した電子部品と 基板表面に設けた接続部との間を接続する内部配線部の配線不良を検出することができる 部品内蔵基板及びその配線不良検査方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0005]

多層配線基板に内蔵された電子部品の電極と基板表面に設けられた接続部とを接続する 内部配線部に配線不良が生じている場合は、内部配線部の抵抗値が正常値よりも大きくな る。

40

ここで、請求項1の発明によれば、電子部品の電極または内部配線部の所定部位と基板の表面に設けられた検査用接続部との間は検査用内部配線部で接続されているので、内部配線部に配線不良を生じている場合は、内部接続部と検査用接続部とを通じた抵抗値が高くなる。従って、接続部と検査用接続部との間の抵抗値を測定することにより、内部配線部の配線不良を検出することが可能となる。

[0006]

請求項2の発明によれば、検査用配線部は最短距離で形成されているので、検査用配線 部の抵抗値を最小限に抑制することができる。

請求項3の発明によれば、ビアを直線的に接続して検査用配線部を形成しているので、

検査用配線部を最短距離で容易に形成することができる。

[0007]

請求項4の発明によれば、チップ受動部品の電極は表裏面が接続可能であるのが一般的であることから、チップ受動部品の電極に内部配線部を接続し、その電極に検査用内部配線部を接続することにより、内部配線部全体の配線不良を検出することができる。

[0008]

請求項5の発明によれば、基板の生産効率を高めることができると共に、品質の安定化を図ることができる。

請求項 6 の発明によれば、接続部と検査用接続部との間の抵抗値を測定し、その抵抗値が正常値と異なる場合は、内部配線部の配線不良と判断することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0009]

以下、本発明を車載用基板に適用した一実施例について図1ないし図5を参照して説明 する。

図2は、車載用基板を模式的に示す斜視図である。この図2において、車載用基板1は、多層配線基板2を主体に構成されている。多層配線基板2の部品実装面には各種タイプの表面実装電子部品3が搭載されており、多層配線基板2の表面及び内部に形成された図示しない配線部により互いに接続されて所定の電子回路を構成している。

ここで、多層配線基板 2 の内部には、例えばチップ抵抗(電子部品、チップ受動部品に相当) 4 が内蔵されており、配線部により他の電子部品と接続されることにより電子回路 を構成する抵抗として機能するようになっている。

[0010]

図1は、多層配線基板2に内蔵されたチップ抵抗を模式的に示している。尚、図1では、チップ抵抗4のみを図示し、表面実装電子部品3の図示を省略した。この図1において、多層配線基板2は、後述する熱可塑性樹脂からなる多数の絶縁層5を積層して構成されている。絶縁層5の表面及び各絶縁層5間には、例えば銅箔からなる導体パターン6が形成されていると共に、所定部位には絶縁層5間の導体パターン6を電気的に接続するビア7が形成されており、上から第3層目及び第6層目に形成されたビア7がチップ抵抗4の電極4aに接続している。本実施例では、導体パターン6とビア7とから内部配線部8を構成している。

尚、多層配線基板2の絶縁層5の層数は、実際には十数層~数十層にもなるが、図1では便宜上8層のみを図示している。また、チップ抵抗4の厚み寸法は、絶縁層5の2層分の厚みにほぼ等しいものとして図示している。

[0011]

さて、上記構成の多層配線基板2を製造するための本実施例に係る製造方法について、図3ないし5も参照して述べる。

図3は、図1に示した多層配線基板2の分解図である。多層配線基板2を製造するにあたっては、まず、絶縁層5の元となる基材9を形成する基材形成工程を実行する。この基材9は、絶縁層5を構成する結晶転移型の熱可塑性樹脂からなるフィルム10上に、導体パターン6を形成すると共に、フィルム10の所定部位にビア7を構成するためのビアホール11を形成し、さらにビアホール11内に導電ペースト12を充填して形成されている。

[0012]

フィルム10は、例えばポリエーテルエーテルケトン(PEEK)樹脂35~65重量%と、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂35~65重量%とを含んだ材料からなり(商品名「PAL-CLAD」)、厚みが例えば25~75ミクロンで多層配線基板2の大きさに対応した形状に形成されている。この樹脂材料は、図5に示すように、例えば200付近では軟質となるが、それより低い温度でも高い温度でも硬質となる特性を呈すると共に(さらに高い温度(約400)では溶解する)、高温から温度低下する際には、200 付近でも硬質を保つ特性を呈するようになっている。

10

20

30

[0013]

図4は、基材9を製作する手順を示している。まず、同図(a)に示すようにフィルム10の表面(上面)に貼付けられた導体箔としての銅箔13に対して、エッチングにより 導体パターン6を形成する工程を実行する。

[0014]

この導体パターン6の形成後、フィルム10の裏面(下面)には、例えばポリエチレンナフタレート(PEN)製の保護フィルム14が貼付される(同図(b))。そして、保護フィルム14側からの例えば炭酸ガスレーザの照射により、フィルム10の所定部位に導体パターン6を底面とする有底のビアホール11を形成する工程を実行する(同図(c))。この場合、炭酸ガスレーザの出力及び照射時間の調整により、導体パターン3に穴が開かないようにしている。

[0015]

次に、ビアホール 1 1 内に、導電ペースト 1 2 を充填する工程を実行する(同図(d))。この導電ペースト 1 2 は、銅、銀、スズ等の金属粒子に、バインダ樹脂や有機溶剤を加えて混練してペースト状としたものであり、例えばメタルマスクを用いたスクリーン印刷によりビアホール 1 1 内に印刷充填される。このとき、図 3 で上から 3 層目を構成する基材 9 については、チップ抵抗 4 の各電極に対応した位置にも、ビアホール 1 1 が形成されて導電ペースト 1 2 が充填されるようになる。導電ペースト 1 2 の充填後、フィルム 1 0 から保護フィルム 1 4 が剥がされる(同図(e))。

[0016]

図1に示す4層目及び5層目の基材形成工程にあっては、図3に示すようにフィルム10においてチップ抵抗4が配置される部分に、該チップ抵抗4に対応した矩形状の孔15が形成される。

[0017]

次に、上述のようにして形成された1層から4層の基材9と、これらの基材9と同様に形成した5層から8層の基材9を上下に逆さまとなるように積層する積層工程を実行する。この積層工程においては、図3に示すように、チップ抵抗4が、上から3層目の基材9と6層目の基材9との間に挟まれた形態で4層目と5層目の2枚の基材9の孔15内に嵌り、その位置決め状態で、チップ抵抗4がその電極面を表面及び裏面として配置されるようになる。

尚、チップ抵抗4の電極4aには、導電ペースト12と拡散接合が可能な金属皮膜(例えば金、銅、すずなど)が形成されている。

[0018]

次に、上述のように積層された8層の基材9を一括して熱プレスする工程を実行する。この熱プレス工程では、基材9が図示しない真空加圧プレス機にセットされ、例えば200~350 に加熱された状態で、0.1~10Mpaの圧力で上下方向に加圧される。このとき、上記各基材9を構成するフィルム10は、図4に示すような温度に対する弾性率変化を生ずるので、この熱プレスの工程により、各フィルム10が熱により一旦軟化した状態で加圧されることによって相互に融着し、その後結晶化(硬化)して一体化するようになる。

[0019]

このような工程の結果、図1に示すように、多層の絶縁層5間に導体パターン6が埋込まれると共に、ビアホール11内の導電ペースト12が硬化してビア7が形成されるようになる。これと同時に、チップ抵抗4が、その各電極が上から3層目と6層目の絶縁層5の導体パターン6に接続された状態で、絶縁層5内に埋込まれるようになり、以て、多層配線基板2が構成されるのである。

[0020]

このとき、チップ抵抗4の電極4aの表面及び裏面においては、チップ抵抗4の電極4aの金属皮膜と、ビアホール11内の導電ペースト12とが相互拡散して合金層を形成し、チップ抵抗4の電気的接続が行われて且つ機械的にも高い接合性を得ることができる。

10

20

30

40

10

20

30

40

50

また、基材 9 のうち、チップ抵抗 4 が配置される部分に孔 1 5 を形成しておいたことにより、熱プレス工程においてチップ抵抗 4 が、基材 9 の材料(熱可塑性樹脂)を押しのけて多層配線基板 2 の変形を招く等の弊害の発生を未然に防止することができる。

[0021]

以上のような構成により、多層配線基板2の1層目と8層目の表面に形成された導体パターン(以下、ランド)とチップ抵抗4の電極4aとが内部配線部である導体パターン6とピア7を介して接続された形態となる(図1では、図示右上側に形成された導体パターン(以下、ランド(接続部に相当)6aと図示左下側に形成された導体パターン(以下、ランド(接続部に相当)6b)との間に内部配線部を介してチップ抵抗4が接続された形態となっている)。

[0022]

ところで、上述した内部配線部は導体パターン6とビア7とを積層して接合することにより形成されていることから、それらの間の接合が不十分の場合は、配線不良を生じて抵抗値が正規値よりも大きくなることがある。このように内部配線部に配線不良を生じた場合は、車載用基板1が車両に搭載されて使用されるという事情から、熱或いは振動の影響を受けて配線不良が進行し、ついには内部配線部の抵抗値が過度に大きくなって電子回路が正常に動作しなくなってしまう虞がある。この場合、多層配線基板2の1層目と3層目の表面に形成されたランド間の抵抗値を測定することにより内部配線部の抵抗値の増大を検出することも可能であるものの、ランド6a,6b間に位置するチップ抵抗4の抵抗値が大きい場合(例えば1M))は、抵抗値の増大がチップ抵抗4の抵抗値の許容範囲内に埋没してしまい、内部配線部の抵抗値の増大を検出することができない。

[0023]

具体的には、チップ抵抗4の抵抗値が1Mの場合は、その許容範囲は1M±50Kとなる。内部配線部で配線不良を生じ、その抵抗値が3であったとすると、そのような抵抗値の増大はチップ抵抗4の許容範囲内に埋没してしまうことになり、検出ができないことになる。

[0024]

そこで、本実施例では、多層配線基板の基板表面においてランド6a,6bと反対側となる基板表面に導体パターンから検査用ランド(検査用接続部に相当)6c,6dをそれぞれ形成すると共に、その検査用ランド6c,6dとチップ抵抗4の電極4aとの間を、導体パターン6及びビア7とから構成される検査用内部配線部16で接続するようにした。この場合、検査用ランド6c,6dを、多層配線基板の基板表面においてチップ抵抗4の電極4aの垂直方向となる位置に形成すると共に、検査用ランド6c,6dとチップ抵抗4の電極4aとの間を直線的に接続したビア7により接続するようにした。この場合、検査用内部配線部16は、上述した基材9を形成する際に同時に形成することができるものであることから、特別な手段或いは工程を用いることなく形成することができる。

[0025]

さて、例えばランド6aとチップ抵抗4の電極4aとを接続する内部配線部の配線不良を検出するには、ランド6aと当該ランド6aに対して反対側の基板表面に形成された検査用ランド6cとの間の抵抗値を測定する。この場合、ランド6aと検査用ランド6cとはチップ抵抗4の電極4aを介して接続されていることから、チップ抵抗4が介在せず、その抵抗値は、内部配線部8の抵抗値と検査用内部配線部16の抵抗値との合計となる。この場合、検査用内部配線部16は、ビア7を直線的に接続して形成されているので、その抵抗値は極めて低いと共に、配線不良を生じる可能性も極めて低いものと見なすことができる。従って、ランド6aと検査用ランド6cとの間の抵抗値は、内部配線部の抵抗値と見なすことができる。

[0026]

ここで、通常ではランド 6 a と検査用ランド 6 c との間の抵抗値は 1 0 0 m であることから、例えばその測定値が 3 (正常値の 3 0 倍)となったときは、内部配線部が配線不良である可能性があると判断することができる。このように内部配線部が配線不良であ

ると判断したときは、検査対象の多層配線基板2を不良品として廃棄する。

同様に、ランド 6 b と検査用ランド 6 d との間の抵抗値を測定することにより、もう一方の内部配線部 8 の配線不良を検出することができる。

[0027]

そして、上述のように内部配線部8に配線不良がないことを確認したときは、多層配線基板2の部品実装面の所定部位に例えばスクリーン印刷によりはんだペーストを塗布してから表面実装電子部品3を搭載し、リフローにより熱を加えることにより、表面実装電子部品3を多層配線基板2に実装することができ、もってチップ抵抗を含む所定の電子回路からなる車載用基板1を作成することができる。

[0028]

このような実施例によれば、多層配線基板 2 に内蔵されたチップ抵抗 4 の電極 4 a と多層配線基板 2 の基板表面に形成されたランド 6 a , 6 b との間を導体パターン 6 及びビア 7 からなる内部配線部 8 で接続した構成において、多層配線基板 2 の反対側の基板表面に検査用ランド 6 c , 6 d とチップ抵抗 4 の電極 4 a との間を検査用配線部で接続するようにしたので、ランド 6 a , 6 b と検査用ランド 6 c , 6 d との間の抵抗値を測定することにより、内部配線部 8 の配線不良を検出することができる。

しかも、基材 9 を製作する際に、内部配線部 8 に加えて検査用内部配線部 1 6 も同時に 形成するようにしたので、コストが大幅に上昇することなく容易に実施することができる

[0029]

本発明は、上記実施例に限定されることなく、次のように変形または拡張できる。

図6に示すように、検査用ランド6 c , 6 dをランド6 a , 6 bと同一の基板表面にそれぞれ形成すると共に、内部配線部8においてチップ抵抗4の電極4 a 側となる最終の導体パターン6 e , 6 f と検査用ランド6 c , 6 dとを接続する検査用内部配線部16を形成し、ランド6 a , 6 bと検査用ランド6 c , 6 dとの間の抵抗値を測定することにより、内部配線部8の配線不良を検出するようにしてもよい。

[0030]

また、図7に示すように、ランド6a,6bが形成された基板表面に対して反対面となる基板表面に検査用ランド6c,6dを形成すると共に、内部配線部8においてチップ抵抗4の電極4a側となる最終の導体パターン6e,6fと検査用ランド6c,6dとの間を検査用内部配線部16で接続し、ランド6a,6bと検査用ランド6c,6dとの間の抵抗値を測定することにより、内部配線部8の配線不良を検出するようにしてもよい。

[0031]

また、図8に示すように多層配線基板2の一方の基板表面に一対のランド6a,6bを形成し、それらのランド6a,6bとチップ抵抗4の各電極4aとをそれぞれ内部配線部8で接続することにより、チップ抵抗4を含む電子回路が構成されている場合は、多層配線基板2の他方の基板表面に一対の検査用ランド6c,6dを形成し、当該検査用ランド6c,6dとチップ抵抗4の各電極4aとを検査用内部配線部16で接続することにより、内部配線部8の配線不良を検出するようにしてもよい。

[0032]

電子部品としてチップ抵抗4を採用したが、それ以外でも各種の電子部品(センサ類を含む)を多層配線基板2内に埋込んだ形態の基板に適用するようにしてもよい。

上記実施例では絶縁層 5 (基材 9 のフィルム 1 0)を構成する結晶転移型の熱可塑性樹脂として、PEEK樹脂とPEI樹脂とを混合したものを採用したが、PEEK樹脂単体、あるいはPEI樹脂単体、さらにはそれらにフィラーを添加したものや液晶ポリマー等を採用することも可能であるなど、本発明は要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更して実施し得るものである。

【図面の簡単な説明】

[0033]

10

20

30

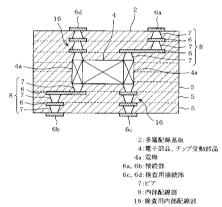
- 【図1】本発明の一実施例における多層配線基板の模式的に示す縦断側面図
- 【図2】車載用基板を示す斜視図
- 【図3】多層配線基板を分解して示す図
- 【図4】基材の製作工程を示す図
- 【図5】熱可塑性樹脂の処理温度と弾性率との関係を示す図
- 【図6】本発明のその他の実施例を示す図1相当図(その1)
- 【図7】本発明のその他の実施例を示す図1相当図(その2)
- 【図8】本発明のその他の実施例を示す図1相当図(その3)
- 【図9】従来例を示す図1相当図

【符号の説明】

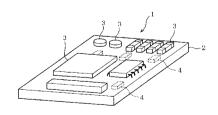
[0034]

図面中、1は車載用基板、2は多層配線基板、3は表面実装電子部品、4はチップ抵抗(電子部品、チップ受動部品)、4 a は電極、6は導体パターン、6 a , 6 b はランド(接続部)、6 c 、6 d は検査用ランド(検査用接続部)、7はビア、8 は内部配線部、16 は検査用内部配線部である。

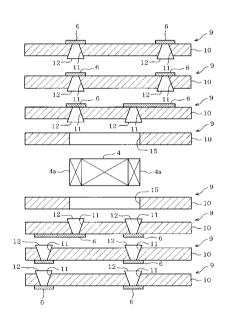
【図1】



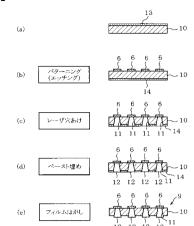
【図2】



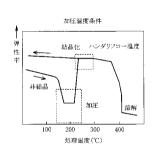
【図3】



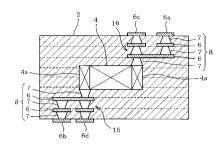
【図4】



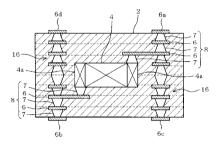
【図5】



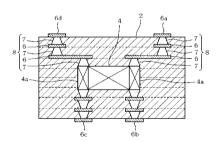
【図6】



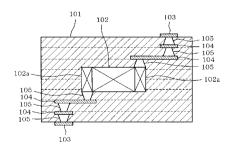
【図7】



【図8】



【図9】



フロントページの続き

(72)発明者 清水 元規

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

審査官 吉澤 秀明

(56)参考文献 特開2006-344847(JP,A)

特開2007-035739(JP,A)

特開2006-011507(JP,A)

特開2003-086949(JP,A)

特開平01-268191(JP,A)

特開2005-17263(JP,A)

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)

H05K 3/46

H 0 5 K 3 / 0 0

H01L 23/12